PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-352407

(43) Date of publication of application: 06.12.2002

(51)Int.Cl.

G11B 5/66 G11B 5/64 G11B 5/65 G11B 5/673 G11B 5/738

(21)Application number: 2001-260571

(22)Date of filing:

30.08.2001

(71)Applicant : HITACHI MAXELL LTD

(72)Inventor: YAMANAKA HIDEAKI

INABA NOBUYUKI KANDA TETSUNORI FUJITA SHIOJI

MATSUNUMA SATORU TAKEUCHI TERUAKI

(30)Priority

Priority number : 2000359200

Priority date: 27.11.2000

Priority country: JP

2001054254

28.02.2001

JP

2001078630

19.03.2001

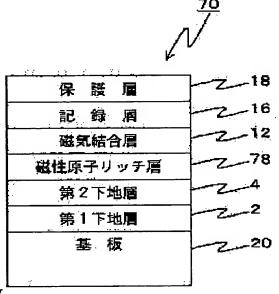
JP

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC RECORDING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium for high density recording that is excellent in thermal stability.

SOLUTION: An in-plane magnetic recording medium 10 is provided with a first NiAl base layer 2, a second CrMo base layer 4, a CoPt ferromagnetic atom rich layer 6, a Ru magnetic coupling layer 12, a CoCrPtB recording layer 16, and a carbon protective layer 18 on a substrate 20. The magnetic coupling layer 12 brings about the exchange coupling force between the recording layer 16 and the ferromagnetic atom rich layer 6. Since ferromagnetic atom concentration in the ferromagnetic atom rich layer is higher than that of the recording layer 16, the exchange coupling which acts between the ferromagnetic atom rich layer and recording layer are enhanced remarkably. It is possible thereby to provide the magnetic recording device that is excellent in the thermal stability and in the recording stability over a long period of the magnetic recording medium.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of

08.02.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3729763
[Date of registration] 14.10.2005
[Number of appeal against examiner's decision 2005-04203

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 10.03.2005

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.7

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-352407 (P2002-352407A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

(, 21-01-			
G11B 5/66		G11B 5/66 5D006	3
5/64		5/64	
5/65		5/65	
5/673		5/673	
5/738		5/738	
5,100		審査請求 有 請求項の数27 OL (全 20	頁)
(21) 出願番号	特願2001-260571(P2001-260571)	(71) 出願人 000005810	
		日立マクセル株式会社	
(22)出顧日	平成13年8月30日(2001.8.30)	大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号	
		(72) 発明者 山中 英明	
(31)優先権主張番号	特顧2000-359200 (P2000-359200)	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日	女マ
(32)優先日	平成12年11月27日(2000.11.27)	クセル株式会社内	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 稲葉 信幸	
(31)優先権主張番号	特顧2001-54254 (P2001-54254)	大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日	立て
(32)優先日	平成13年2月28日(2001.2.28)	クセル株式会社内	
(33) 優先権主張国	日本(JP)	(74)代理人 100099793	
(31)優先権主張番号	特願2001-78630 (P2001-78630)	弁理士 川北 喜十郎	
(32) 優先日	平成13年3月19日(2001.3.19)		
(33)優先権主張国	日本 (JP)		
		最終頁	こ鏡く

FΙ

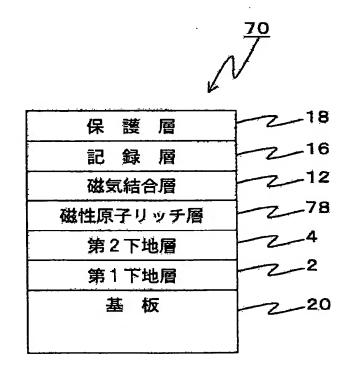
(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体及び磁気記録装置

識別記号

(57)【要約】

【課題】 熱安定性に優れた高密度記録用磁気記録媒体を提供する。

【解決手段】 面内磁気記録媒体10は、基板20上に、NiA1第1下地層2、CrMo第2下地層4、CoPt強磁性原子リッチ層6、Ru磁気結合層12、CoCrPtB記録層16及びカーボン保護層18を備える。磁気結合層12は記録層16と強磁性原子リッチ層6の交換結合力をもたらす。強磁性原子リッチ層は記録層16よりも強磁性原子濃度が高いため、当該強磁性原子リッチ層と記録層との間で働く交換結合が著しく向上する。これにより、磁気記録媒体の熱安定性に優れ、長期間に渡る記録安定性に優れた磁気記録装置を提供することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁気記録媒体であって、

強磁性材料から形成された記録層と;上記記録層を形成する強磁性材料よりも強磁性原子濃度の高い強磁性材料から形成された強磁性原子リッチ層と;上記記録層と上記強磁性原子リッチ層との間に存在する非磁性層と;を含む磁気記録媒体。

【請求項2】 上記強磁性原子リッチ層が、Co、Ni、Fe及びCoNiFe合金からなる群から選ばれた一種から形成されている請求項1に記載の磁気記録媒体。

【請求項3】 上記強磁性原子リッチ層が、Co、Ni 及びFeからなる群から選ばれた一種と遷移金属との合 金から形成されている請求項1に記載の磁気記録媒体。

【請求項4】 更に、上記記録層の磁化を安定化させる磁化安定化層を備え、該磁化安定化層と記録層との間に上記強磁性原子リッチ層が位置し、上記強磁性原子リッチ層が上記磁化安定化層と記録層との間の交換結合を増大するエンハンス層として機能する請求項1に記載の磁気記録媒体

【請求項5.】 更に、上記記録層と上記非磁性層との間に、上記記録層と上記強磁性原子リッチ層との交換結合を増大する第2エンハンス層を備える請求項1または4に記載の磁気記録媒体。

【請求項6】 上記記録層が、Co、NiまたはFeを含む材料から形成されており、上記エンハンス層は上記記録層よりも高濃度のCo、NiまたはFeを含む材料から形成されているととを特徴とする請求項4に記載の磁気記録媒体。

【請求項7】 上記記録層はBを含む請求項6に記載の 30 磁気記録媒体。

【請求項8】 上記エンハンス層が、0.2~2nmの 膜厚を有する請求項14に記載の磁気記録媒体。

【請求項9】 上記非磁性層が、Ruから形成されている請求項1に記載の磁気記録媒体。

【請求項10】 更に、上記磁化安定化層は、第1磁化安定化層及び第2磁化安定化層を含み、第1磁化安定化層と第2磁化安定化層との間に第2非磁性層を備え、第1磁化安定化層と第2非磁性層との間、及び、第2非磁性層と第2磁化安定化層との間の少なくとも一方に、第401磁化安定化層と第2磁化安定化層との間の交換結合を増大する補助エンハンス層を備える請求項4に記載の磁気記録媒体。

【請求項11】 上記補助エンハンス層が、第1磁化安定化層と第2非磁性層との間に形成された第1補助エンハンス層と;第2非磁性層と第2磁化安定化層との間に形成された第2強磁性原子リッチ層と;を含む請求項10に記載の磁気記録媒体。

【請求項12】 更に、基板と;第2非磁性層と;それらの間に位置し、強磁性材料から形成され且つ記録層の 50

磁化を安定化させる磁化安定化層と;を含み、第2非磁性層に対して上記基板と反対側に上記強磁性原子リッチ層が位置付けられている請求項1 に記載の磁気記録媒

【請求項13】 更に、基板と;第2非磁性層と;それ ちの間に位置する第2強磁性原子リッチ層と;を含み、 第2非磁性層に対して上記基板と反対側に上記強磁性原 子リッチ層が位置付けられている請求項1に記載の磁気 記録媒体。

10 【請求項14】 磁気記録媒体において、 下地層と、

強磁性材料から形成された記録層と、

上記下地層と上記記録層との間で下地層に接して存在 し、強磁性材料から形成され、下地層と記録層との格子 間隔を調整するための格子間隔調整層と、

上記記録層と上記格子間隔調整層との間に存在する非磁 性層とを含み、

上記格子間隔調整層の配向面における格子間隔と上記下 地層の配向面における格子間隔との差が、上記記録層の 20 配向面における格子間隔と上記下地層の配向面における 格子間隔との差よりも小さいことを特徴とする磁気記録 媒体。

【請求項15】 上記記録層の配向面における格子間隔を a_1 、上記格子間隔調整層の配向面における格子間隔を a_2 、上記下地層の配向面における格子間隔を a_3 とし、ミスマッチ $\Delta1$ 及び $\Delta2$ を、それぞれ、

Δ1= | (a₁ - a₃) / a₃ | ×100 Δ2= | (a₂ - a₃) / a₃ | ×100 と定義するとき、

30 $\Delta 1 > \Delta 2$

の関係を満たすことを特徴とする請求項14に記載の磁 気記録媒体。

【請求項16】 更に、

 $\Delta 2 < \Delta 1 < 10.25$

目つ

 $(5/10.25) < (\Delta 1/\Delta 2) < 1$

の関係を満たすことを特徴とする請求項15に記載の磁 気記録媒体。

【請求項17】 上記格子間隔調整層は、記録層と同じ 結晶構造を有することを特徴とする請求項14に記載の 磁気記録媒体。

【請求項18】 上記格子間隔調整層に含まれる磁性原子の割合が、上記記録層に含まれる磁性原子の割合よりも大きいことを特徴とする請求項14に記載の磁気記録 媒体。

【請求項19】 上記格子間隔調整層の飽和磁化をMs 1、上記記録層の飽和磁化をMs2としたとき、Ms1 >Ms2の関係を満たすことを特徴とする請求項18に 記載の磁気記録媒体。

· 【請求項20】 上記格子間隔調整層が、Co、Ni、

1

Fe及びCoNiFe合金からなる群から選ばれた一種 から形成されていることを特徴とする請求項14に記載 の磁気記録媒体。

【請求項21】 上記格子間隔調整層が、Co、Ni及 びFeからなる群から選ばれた一種と遷移金属とを含む 合金から形成されていることを特徴とする請求項14に 記載の磁気記録媒体。

【請求項22】 上記非磁性層が、Ruから形成されて いることを特徴とする請求項14に記載の磁気記録媒

【請求項23】 上記格子間隔調整層がまた、上記記録 層の磁化を安定化させるとともに記録層の保磁力を増大 する層として機能することを特徴とする請求項14に記 載の磁気記録媒体。

【請求項24】 上記記録層が面内方向の磁化を有する 請求項1または14に記載の磁気記録媒体。

【請求項25】 上記磁気記録媒体の外部磁界に対する 磁化曲線がヒステリシスループを示し、磁化を飽和させ た後に外部磁界を低下させたときに、外部磁界に対する 磁化の変化率が極大を示す点が正の外部磁界の領域に存 20 在し、且つ磁化曲線から求めた交換結合磁界が1 k O e 以上である請求項1または14に記載の磁気記録媒体。

【請求項26】 磁気記録媒体であって、

強磁性材料から形成された記録層と:強磁性材料から形 成され、記録層の磁化を安定化させる磁化安定化層と; 上記記録層と上記磁化安定化層との間に存在する非磁性 層と:上記非磁性層と記録層の間並びに非磁性層と磁化 安定化層の間の少なくとも一方に存在し、上記記録層を 形成する強磁性材料よりも強磁性原子濃度の高い強磁性 材料から形成された強磁性原子リッチ層とを含む磁気記 30 録媒体。

【請求項27】 請求項1、14または26に記載の磁 気記録媒体と;上記磁気記録媒体に情報を記録又は再生 するための磁気ヘッドと;上記磁気記録媒体を上記磁気 ヘッドに対して駆動するための駆動装置と;を含む磁気 記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気記録媒体及び 磁気記録装置に関し、特に、熱安定性に優れ、高密度記 40 録に好適な面内磁気記録媒体及びその面内磁気記録媒体 を装着した磁気記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の高度情報化社会の進展にはめざま しいものがあり、文字情報のみならず音声及び画像情報 を髙速に処理することができるマルチメディアが普及し てきている。マルチメディアの一つとしてコンピュータ 等に装着される磁気記録装置が知られている。現在、と のような磁気記録装置の記録密度を向上させつつ小型化 する方向に開発が進められている。

【0003】典型的な磁気記録装置は複数の磁気ディス クをスピンドル上に回転可能に装着している。各磁気デ ィスクは基板とその上に形成された磁性膜から構成され ており、情報の記録は特定の磁化方向を有する磁区を磁 性膜中に形成することにより行なわれる。

[0004] とのような磁気記録装置の高密度記録化を 実現するためには、磁性膜を構成する粒子径を微小化す るとともに各粒子間の相互作用を低下させることが要望 されている。しかしながら、粒子径の微小化と粒子間相 互作用の低下は、粒子の熱安定性を低下させるという問 題がある。

【0005】磁気ディスク、特に面内方向の磁化を有す る磁気ディスクの熱安定性を向上させる技術として、記 録層の下地層として、軟磁性のいわゆるキーパー層を設 ける方法や記録層の磁化と逆向きの磁化を有する層を設 ける方法が知られている。後者の方法の一つとして、図 18に示したように、磁気ディスクのCoCrPtB記 録層とCoCrPtB磁化安定化層との間に、磁気結合 層としてのRu薄膜を形成することにより熱安定性を向 上させる技術がE.N. Abarra et al.の文献に発表されて LAZ (E.N. Abarra et al. TECHNICAL REPORT OF IEIC E. MR2000-34(2000-10))。図18に示した磁気ディス ク構造において、記録層と磁化安定化層との間に磁気結 合層として0.5~1nm程度の厚みのRu層を介在さ せると、記録層と磁化安定化層との間に反強磁性的な交 換結合が働く。従って、それらの層は反平行の磁化を有 するために、記録層の磁化が磁化安定化層により安定化 される。このRu層による反強磁性的な交換結合は、記 録層の磁化を一層熱的に安定化させ、磁気ディスクの記 録再生特性を改善することができることがこの文献に示 されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、磁気記 録装置の更なる髙密度記録化を実現するには、上記文献 に開示された磁気ディスクよりも一層熱安定性に優れた 磁気ディスクを備える磁気記録装置が要求されている。

【0007】本発明の第1目的は、熱安定性に優れた磁 気記録媒体、特に面内磁気記録媒体及びそれを備えた磁 気記録装置を提供することにある。

【0008】本発明の第2の目的は、記録した情報の安 定性(記録安定性)に優れた磁気記録装置を提供すると

【0009】本発明の第3の目的は、高密度磁気記録に 適した磁気記録媒体及びそれを装着した磁気記録装置を 提供することにある。

【0010】本発明の第4の目的は、記録層の保磁力が 髙められた磁気記録媒体を提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の態様に従 50 えば、磁気記録媒体であって、強磁性材料から形成され

【0014】かかる強磁性原子リッチ層は、記録層との

た記録層と:上記記録層を形成する強磁性材料よりも強 磁性原子濃度の高い強磁性材料から形成された強磁性原 子リッチ層と:上記記録層と上記強磁性原子リッチ層と の間に存在する非磁性層と;を含む磁気記録媒体が提供 される。

【0012】本発明者は、図18に示した従来型構造を 有する磁気ディスクをさらに改良させるべく研究を重ね たところ、磁化安定化層の代わりに、記録層を形成する 強磁性材料よりも強磁性原子濃度の高い材料を用いて形 成された強磁性原子リッチ層を形成することにより、強 10 磁性原子リッチ層と記録層との間に生じる交換結合力が 著しく高くなることを見出した。かかる強磁性原子リッ チ層と記録層との間に生じる交換結合力は、図18に示 した従来型構造を有する磁気ディスクの記録層と磁化安 定化層との間に働く交換結合力よりも大きくなってい る。とのように、記録層と強磁性原子リッチ層との間に は強い交換結合力が発生しているので記録層の磁化を安 定化するととができるため、記録層の熱安定性は、図1 8に示した従来の磁気ディスクよりも一層高まり、更な る髙密度記録を実現することができる。本発明におい て、用語「強磁性原子」とは、単体で強磁性を示す元素 をいい、具体的には、コバルト(Co)、ニッケル(N i) または鉄(Fe) である。

【0013】強磁性原子リッチ層は、記録層を形成する 強磁性材料よりも強磁性原子濃度の高い強磁性材料を用 いて形成され、例えば、記録層がCo、NiまたはFe を含む強磁性材料から形成されている場合には、記録層 よりも高濃度のCo、NiまたはFeなどの強磁性原子 を含む強磁性材料から形成することができる。また、強 磁性原子リッチ層は、Co、NiもしくはFeなどの単 30 体金属またはCoNiFe合金から形成することもでき る。または強磁性原子リッチ層は、Со、NiまたはF eと、遷移金属との合金から形成され得る。この場合、 遷移金属は、Pt、Au、Ag、Cu、Pdなどの貴金 属にし得る。本発明においては、強磁性原子リッチ層を 構成する強磁性材料の強磁性原子濃度が、記録層を構成 する磁性材料の強磁性原子濃度よりも高ければ、強磁性 原子リッチ層と記録層との間に生じる交換結合力を高め る効果が得られるが、十分な効果を得るためには、後述 する実施例の結果からすると、強磁性原子リッチ層を構 40 成する強磁性材料の強磁性原子濃度が、記録層を構成す る磁性材料の強磁性原子濃度よりも絶対値で19%以上 高いことが望ましく、特に強磁性原子リッチ層の強磁性 原子濃度が100%であることが望ましい。かかる強磁 性原子リッチ層により、強磁性原子リッチ層と記録層と の間に生じる交換結合力は、図18に示した従来の磁気 ディスクの磁化安定化層と記録層との間で生じる交換結 合力よりも大きくなる。それゆえ、記録層の熱安定性は 従来よりも一層高まり、更なる高密度記録を実現すると とができる。

間で働く交換結合力を有意義にするために1nm~5n mの膜厚を有することが好ましい。

【0015】本発明の磁気記録媒体は、更に、記録層と 交換結合して記録層の磁化を安定化するための磁化安定 化層を備え得る。との場合、強磁性原子リッチ層は記録 層と磁化安定化層との間に位置することが好ましい。以 下、その理由について説明する。

【0016】本発明者らは、研究の結果、図18に示し た従来型構造を有する磁気ディスクのRu層(非磁性 層)と記録層との界面及び/またはRu層(非磁性層) と磁化安定化層との界面に、数原子層のCo層を介在さ せることにより、上記記録層と上記磁化安定化層との間 の交換結合を著しく向上させることができることを見出 した。上記界面に介在させる層はCoのみならず、記録 層よりも強磁性原子濃度が高い材料であればよく、記録 層と磁化安定化層の間の交換結合を向上させるととがで きる後述する種々の物質から構成することができる。す なわち、磁気記録媒体が磁化安定化層を備える場合に

20 は、上記界面に強磁性原子リッチ層を位置付ければ、記 ---録層と磁化安定化層との間の交換結合力を向上するとと ができる。本明細書においては、強磁性原子リッチ層 は、磁化安定化層を備える場合に記録層と磁化安定化層 の間の交換結合を増大(エンハンス)させる機能をも備 えるため、「エンハンス層」とも称する。

【0017】本発明者の知見によると、磁化安定化層と 記録層との間に位置付けた強磁性原子リッチ層すなわち エンハンス層が記録層と磁化安定化層との間の交換結合 を向上させることができる理由は以下の通りである。図 18に示した従来型の磁気ディスクでは、СоСгР t B記録層とCoCrPtB磁化安定化層がRu層を介し て積層されている。ととで、記録層と磁化安定化層はR u原子層を介して交換結合している。との交換結合は、 記録層と磁化安定化層中のCo原子同士がRu原子を介 して電子軌道が結合していることに基づくと考えられ る。このような結合は、例えば、GMRヘッドにおける 人工格子中の結合にも見られる。

【0018】しかしながら、記録層とRu層との界面を 観察すると、記録層はCoCrPtBから構成されてい るために、記録層の結晶粒子はCoリッチでありその粒 界はCェリッチな組成を示しており、この結果、記録層 のRu層側の表面にはCo原子よりも多くのCrの原子 が露出していると考えられる。磁化安定化層もまた記録 層と同様にCoCr合金(CoCrPtB)から構成さ れているために、磁化安定層のRu層側の表面にはCo を覆うCr原子が多量に露出していると考えられる。C れらのCr原子層は、前述のRu原子を介する記録層と 磁化安定化層中のCo原子同士の電子結合を阻害し、記 録層と磁化安定化層の交換結合を弱めていると考えられ 50 る。本発明では、Cr原子が表面に露出している記録層 または磁化安定化層を、記録層よりもCoなどの磁性原子の濃度の高いエンハンス層で覆うことにより、記録層と磁化安定化層との交換結合を、エンハンス層を構成するCoなどの原子間における交換結合により改善させていると考えられる。したがって、磁化安定化層を備える場合には、磁化安定化層と記録層との間にエンハンス層を位置付けることによって、磁化安定化層で安定化された記録層の磁化が、エンハンス層による磁化安定化層と記録層との間の交換結合力の増大によって、より一層安

定化するため、従来よりも更に高密度記録を実現すると

とができる。

【0019】上記エンハンス層は、Co、Niもしくは FeまたはCoNiFe合金から形成し得る。または、エンハンス層は、Co、NiまたはFeと、遷移金属と の合金から形成され得る。との場合、遷移金属は、Pt、Au、Ag、Cu、Pdなどの貴金属にし得る。それらの原子または合金は、非磁性層を介して電子的に結合して交換結合磁界を増大する働きがある。あるいは、記録層または磁化安定化層がCo、NiまたはFeを含む材料から形成されている場合には、記録層または磁化 20-安定化層より高濃度のCo、NiまたはFeを含む材料 からエンハンス層を形成することもまた有効である。

【0020】本発明において、磁化安定化層は、記録層 の磁化を安定化するのであれば任意の強磁性材料及び膜 厚を選ぶことができる。更には、記録層の結晶成長性の 観点からすると、磁化安定化層は、例えば、記録層を構 成する主成分と同一の主成分から形成されていることが 好ましい。また、磁化安定化層は、記録層の磁化を安定 化することが可能な磁化及び磁気異方性を有する必要が あるため、ある程度の膜厚を有することが望ましい。し 30 かしながら、磁化安定化層の膜厚が厚すぎると磁化安定 化層の保磁力が大きくなり、記録層と磁化安定化層の磁 化が反平行にならなくなる恐れがある。また、媒体に対 して磁気ヘッドが位置付けられる側において有効な漏れ 磁界を発生させるために、磁化安定化層の磁化は記録層 の磁化よりも小さくなければならないという制約もあ る。かかる理由から、磁化安定化層の膜厚は、記録層の 膜厚の1/5~3/5の範囲内にあることが好ましい。 [0021] 本発明の磁気記録媒体においては、更に、 上記非磁性層と記録層の間に第2のエンハンス層を設け 得る。本発明では、磁化安定化層を設け、磁化安定化層 と記録層との間に強磁性原子リッチ層を位置付けたとき に、記録層と非磁性層との間に第2のエンハンス層を形 成することが、記録層と磁化安定化層の間の交換結合を 一層高めるために望ましい。かかる第2のエンハンス層 は、記録層と強磁性原子リッチ層との間で働く交換結合 のエンハンス効果を有意義にするために0.2~2.0 nmの膜厚を有することが望ましい。

【0022】上述のように磁化安定化層と設け、磁化安 合金又はNi合金は、母元素以外にCr、Ti、Ta、 定化層と記録層との間に強磁性原子リッチ層を位置付け 50 V、Ru、W、Mo、Nb、Ni、ZrまたはAlを含

8

た場合、磁化安定化層を第1及び第2磁化安定化層から構成し、第1磁化安定化層と第2磁化安定化層との間に第2の非磁性層を設け得る。この場合、第1磁化安定化層と第2時程層との間、及び、第2非磁性層と第2磁化安定化層との間の少なくとも一方に、第1磁化安定化層と第2磁化安定化層との間の交換結合を増大する補助エンハンス層を備え得る。さらに、上記補助エンハンス層が、第1非磁性層及び第1磁化安定化層の間に形成された第1補助エンハンス層と;第1非磁性層及び第2磁化安定化層の間に形成された第2補助エンハンス層と;を含み得る。補助エンハンス層は、上記エンハンス層と同じ材料から構成され得る。

【0023】上記エンハンス層(及び補助エンハンス層)は、交換結合のエンハンス効果を有意義にするために、0.2~3nm、好ましくは、0.2~2nmの膜厚を有することが望ましい。

【0024】本発明の第1の態様の磁気記録媒体において記録層は結晶質であって、該結晶質相がコバルト(Co)を主体とした合金にしてよい。このCo合金においては、CoにCr、Pt、Ta、Nb、Ti、Si、B、P、Pd、V、Tb、Gd、Sm、Nd、Dy、Ho、若しくはEu、又はそれらの組み合わせを含み得る

【0025】とこで、記録層にクロム(Cr)を含む と、Соを主体とした結晶粒子(磁性粒子)の粒界近傍 又は粒界部にCrの偏析部分を形成することができる。 記録層中にさらにTa、Nb、Ti、B若しくはP、又 はそれらの元素の組み合わせを含むと、Crの偏析が促 進される。との偏析によって、磁性粒子間の磁気的相互 作用が低減でき、磁化反転単位を構成する磁性粒子数を 減らすことができる。このように、記録層中に上記添加 物を含ませてCrの偏析を促進させてしまうと、従来の 磁気記録媒体では記録層と磁化安定化層との間の磁気的 相互作用もまた低減してしまい、記録層の熱安定性が低 下する恐れがあった。しかしながら、本発明の磁気記録 媒体では、記録層に上記添加物を含めて記録層中の磁性 粒子間の磁気的相互作用を低減しても、記録層と強磁性 原子リッチ層との間には増大した結合力が働くため、微 小な磁化反転単位でありながらも熱揺らぎに強い磁気記 録媒体をもたらすことができる。本発明においては、記 録層は、上記添加物の中でCェの偏析をより一層促進さ せる材料例えばBを含むことが好ましい。

【0026】本発明の第1の態様の磁気記録媒体は、さらに、基板と、基板上に形成された下地層とを備え得る。この場合、下地層上に強磁性原子リッチ層を備え得る。基板はガラス、ポリカーボネートなどのプラスチックから形成し得る。下地層は、Cr若しくはNi、又は、Cr合金若しくはNi合金から形成され得る。Cr合金又はNi合金は、母元素以外にCr、Ti、Ta、V、Ru W Mo Nb Ni ZrまたはAlを含

み得る。下地層は、磁性層の結晶配向性や格子定数を制 御する目的で使用される。下地層は、単層または複数層 で用いることも可能である。

【0027】また、本発明の磁気記録媒体は、基板と、 第2 非磁性層と、それらの間に位置し、記録層の磁化を 熱的に安定化させる磁化安定化層とを備え得る。この場 合、強磁性原子リッチ層は、第2非磁性層に対して基板 の存在する側と反対側に位置付けられる。第2非磁性層 は、上述の非磁性層と同じ材料から構成され得、磁化安 定化層は、例えば、記録層と同じ材料から構成され得 る。かかる磁気記録媒体は、磁化安定化層により、記録 層の磁化をより一層安定化させることができる。

【0028】また、本発明の第1の態様の磁気記録媒体 は、基板と、第2非磁性層と、それらの間に位置する第 2強磁性原子リッチ層とを備えることができる。この場 合、強磁性原子リッチ層は、第2非磁性層に対して基板 の存在する側と反対側に位置付けられる。第2強磁性原 子リッチ層は、上記強磁性原子リッチ層と同じ材料を用 いて形成し得る。かかる構造の磁気記録媒体は、第2強 磁性原子リッチ層により、交換結合磁界がより一層増大 20 --しているので熱安定性に極めて優れる。

【0029】本発明の第2の態様に従えば、磁気記録媒 体において、下地層と、強磁性材料から形成された記録 層と、上記下地層と上記記録層との間で下地層に接して 存在し、強磁性材料かち形成され、下地層と記録層との 格子間隔を調整するための格子間隔調整層と、上記記録 層と上記格子間隔調整層との間に存在する非磁性層とを 含み、上記格子間隔調整層の配向面における格子間隔と 上記下地層の配向面における格子間隔との差が、上記記 録層の配向面における格子間隔と上記下地層の配向面に おける格子間隔との差よりも小さいことを特徴とする磁 気記録媒体が提供される。

【0030】本発明の磁気記録媒体は、下地層と記録層 との間に強磁性材料から形成される格子間隔調整層を形 成して、格子間隔調整層と下地層との格子間隔との差 を、記録層と下地層との格子間隔の差よりも小さくなる ように制御している。かかる格子間隔調整層により、下米

 $\Delta i = |(a_i - a_s)/a_s| \times 100 (i d l \pm t d 2) \cdot \cdot \cdot (1)$

で定義したとき $K\Delta1>\Delta2$ の関係を満たすことが好ま しい。ただし、(1)式において、記号||は絶対値を 示す。一般に、格子間隔のミスマッチは、複数の層が成 長して積層された積層体の各層の界面の格子間隔の差に 起因する。記録層は、格子間隔調整層上から非磁性層を 介して成長することから、記録層の配向性は、記録層と 格子間隔調整層との格子間隔の差に依存する。一方、格 子間隔調整層の配向性は、格子間隔調整層と下地層との 格子間隔の差に依存する。上記のように、格子間隔調整 層と下地層との間の格子間隔のミスマッチ△2を、記録 層と下地層との間の格子間隔のミスマッチ△1よりも小 さくすることにより、格子間隔調整層を記録層のシード

*地層と記録層との間の格子歪が緩和され、記録層の結晶 配向性が向上するので、記録層の保磁力を増大すること ができる。かかる磁気記録媒体は、図18に示した従来 型構造を有する面内磁気記録媒体の磁化安定化層と同様 に、強磁性材料から形成されているために、記録層の磁 化を安定化させることができる。すなわち、格子間隔調 整層は、下地層と記録層との間の格子歪すなわち格子間 隔のずれを緩和するように作用するシード層としての機 能に加え、記録層の磁化を安定化させる機能を有してい 10 る。したがって、本発明の磁気記録媒体は、記録層に形 成された微小な磁区を安定に保持することができるの で、高密度記録を実用化することができる。本発明にお いて、「格子間隔」とは、配向面における格子間隔を意 味するものとする。

【0031】また、本発明の第2の態様の磁気記録媒体 は、格子間隔調整層により記録層の保磁力を、記録層を 単層で構成した場合よりも増大させることができる。そ のため、記録層に高密度に情報を記録することができる とともに、記録した情報の熱安定性に優れている。ま た、格子間隔調整層は、強磁性材料から形成されている ので非磁性層を介して記録層との間で交換結合力が作用----する。それゆえ、格子間隔調整層は記録層の磁化を安定 化する働きも有する。記録層の保磁力を増大させるため には、格子間隔調整層と記録層との格子間隔のミスマッ チを低減させればよい。格子間隔調整層と記録層との格 子間隔のミスマッチを低減させるためには、例えば、下 地層として、記録層の配向性を制御するとともに、高保 磁力が得られるような記録層の結晶構造に近い構造を有 する下地層を用いればよい。また、記録層の保磁力を増 30 大させるために、格子間隔調整層の結晶粒子径を制御し

【0032】本発明の第2の態様の磁気記録媒体におい て、記録層の配向面における格子間隔をaょ、格子間隔 調整層の格子間隔をaz、下地層の格子間隔をasと し、記録層と下地層との間の格子間隔のミスマッチ△1 及び格子間隔調整層と下地層との間の格子間隔のミスマ ッチム2を次式

層として機能させ、下地層から記録層を所望の配向で層 成長させることがきる。

【0033】下地層と記録層との格子整合性をより一層 高めるためには、格子間隔調整層と記録層との間の格子 間隔のミスマッチ、及び、記録層と下地層との間の格子 間隔のミスマッチをそれぞれ5%以内に低減することが 望ましく、そのためには、上記ミスマッチ Δ 1及び Δ 2 は、△2<△1<10.25、及び、(5/10.2 5) < $(\Delta 2/\Delta 1)$ < 1 の関係を同時に満足すること が好ましい。($\Delta 2/\Delta 1$)の値を、かかる範囲にすれ ば、下地層と記録層との間に格子の歪があるときに、格 50 子間隔調整層でその格子の歪を効果的に緩和して、下地

層上から格子間隔調整層を介して、所望の格子間隔を有する記録層を形成するととができる。これにより、記録層の保磁力をより一層増大させるととができる。

[0034] 本発明において、格子間隔調整層は、記録層の磁化容易軸を面内方向に配向制御する必要があるために、記録層と同じ結晶構造を有することが理想的である。面内記録方式の磁気記録媒体では、格子間隔調整層と記録層との間に交換結合が働く場合、格子間隔調整層と記録層の磁化が平行のときに最も磁気異方性エネルギーが低くなり、それらの磁化の安定性が最も良い状態となる。

【0035】本発明の第2の態様の磁気記録媒体は、格 子間隔調整層の飽和磁化をMs1、記録層の飽和磁化を Ms2としたときに、Ms1>Ms2の関係を満たすこ とが望ましい。そのためには、格子間隔調整層に含まれ る磁性元素の割合が、記録層に含まれる磁性元素の割合 よりも大きくなるように、格子間隔調整層を形成すると とが望ましい。これにより、記録層と格子間隔調整層と の間の交換結合力を更に増大させることができる。図1 8に示した従来型媒体の場合、記録層と磁化安定化層は 同じ材料で構成されており、組成及び結晶構造もまた同 一である。記録層と磁化安定化層はRu層を介して交換 結合しており、この交換結合は、記録層と磁化安定化層 中のCo原子同士がRu原子を介して電子軌道が結合し ていることに基づくと考えられる。本発明では、格子間 隔調整層中の磁性元素の割合を記録層中の磁性元素の割 合よりも高めて、交換結合に寄与する磁性元素を増加さ せているために、記録層と格子間隔調整層の交換結合力 は、図18に示した従来型媒体の記録層と磁化安定化層 の交換結合力よりも増加している。そのため、図18に 30 示した従来型媒体よりも熱安定性を高めることができ

【0036】格子間隔調整層は、例えば、Co、Niも しくはFeを含む合金から形成され得る。または、C o、NiまたはFeと、遷移金属、特に、Pt、Au、 Ag、Cu、Pdなどの貴金属とを含む合金から形成さ れ得る。それらの元素または合金は、非磁性層を介して 電子的に結合して交換結合磁界を増大する働きがある。 [0037] 本発明においては、格子間隔調整層に用い る材料及び膜厚を調整することにより、記録層の保磁力 40 及び記録層と格子間隔調整層との間の交換結合力を制御 することができる。図15に示すように、格子間隔調整 層の膜厚が厚くなると記録層の保磁力が増大し、膜厚を 薄くすると記録層と格子間隔調整層との間の交換結合力 が増大する傾向がある。それゆえ、いずれの特性を重視 するかに従って膜厚を適宜選択し得る。これまでの実験 結果からすれば、格子間隔調整層の膜厚が9.0 nmを 超えると、格子間隔調整層と記録層との間の交換結合 が、反強磁性的な交換結合を示さなくなる場合があると とがわかっている。一方、格子間隔調整層の膜厚が1.

0nm以上であれば、格子間隔調整層とその上に形成される記録層との間の格子整合性を維持して記録層の保磁力を十分に増大できることがわかっている。それゆえ、記録層の保磁力及び記録層と格子間隔調整層との間の交換結合力の双方をバランス良く増大させるには、格子間隔調整層の膜厚は、1.0nm~9.0nmが好ましい。

【0038】本発明の第2の態様の磁気記録媒体において記録層は結晶質であって、該結晶質相がコバルト(Co)を主体とした合金にしてよい。このCo合金においては、CoにCr、Pt、Ta、Nb、Ti、Si、B、P、Pd、V、Tb、Gd、Sm、Nd、Dy、Ho、若しくはEu、又はそれらの組み合わせを含み得る。

【0039】ととで、記録層にクロム(Cr)を含む と、Coを主体とした結晶粒子(磁性粒子)の粒界近傍 又は粒界部にCェの偏析部分を形成することができる。 記録層中に更にTa、Nb、Ti、B若しくはP、又は それらの元素の組み合わせを含むと、Crの偏析が促進 される。この偏析によって、磁性粒子間の磁気的相互作 _ 用が低減でき、磁化反転単位を構成する磁性粒子数を減 らすことができる。従って、CoCr合金に上記添加物 を含む記録層に本発明の格子間隔調整層を組み合わせて 用いることで、微小な磁化反転単位でありながら熱揺ら ぎに強い磁気記録媒体をもたらすことができる。また、 かかる記録層は、結晶粒界に偏析したCェリッチの非磁 性領域により結晶粒間の磁気的な結合が絶たれるので、 記録遷移領域に起因したノイズを抑えることもできる。 【0040】本発明の第2の態様の磁気記録媒体におい て、下地層は、例えば、Cr若しくはNi、又は、Cr 合金若しくはNi合金から形成し得る。Cr合金又はN i合金は、母元素以外にCr、Ti、Ta、V、Ru、 W、Mo、Nb、Ni、ZrまたはAlを含み得る。下 地層は、記録層の結晶配向性や格子間隔を制御する目的 で使用される。下地層は、単層または複数層で用いると とも可能である。

【0041】本発明の第2の態様の磁気記録媒体は更に 基板を備え得る。この場合、基板上に下地層が形成され る。基板はガラス、ポリカーボネートなどのプラスチッ クから形成し得る。

【0042】本発明の第1及び第2の態様の磁気記録媒体において、非磁性層(及び第2非磁性層)は、Ruから形成され得るが、Cれに限らず、Rh、Ir、Hf、Cu、Cr、Ag、Au、Re、Mo、Nb、W、Ta、Vなどの遷移金属、CoCrRuのようなCoCr系の非磁性合金を用い得る。強磁性原子リッチ層と記録層との間の交換結合、記録層と格子間隔調整層との交換結合、または記録層と磁化安定化層との交換結合を一層高めるためにはRuが望ましい。なお、本発明において、非磁性層は、記録層と強磁性原子リッチ層、記録層

と格子間隔調整層、または記録層と磁化安定化層とを磁 気的に結合する働きを有するので磁気結合層とも呼ぶ。 【0043】本発明の第1及び第2の態様の磁気記録媒 体は、それぞれ、例えば、図4及び図16に示すような 磁化曲線で表されるヒステリシスループで表される磁気 特性を有する。以下、第1の態様の磁気記録媒体の場合 に基づいて説明するが、第2の態様の磁気記録媒体にお いても格子間隔調整層と記録層との間で同様の関係があ る。図4に示したヒステリシスループでは、磁気記録媒 体の磁化を飽和させた後に外部磁界を低下させたとき に、外部磁界に対する磁化の変化率が極大を示す点が正 の外部磁界の領域に存在する。磁気記録媒体の磁化が飽 和しているときには、記録層と強磁性原子リッチ層(ま たは格子間隔調整層)の磁化がともに平行である。外部 磁界が低下して磁化の変化率が極大となる領域で、強磁 性原子リッチ層(または格子間隔調整層)と記録層との 間で働く交換結合力のために、強磁性原子リッチ層(ま たは格子間隔調整層)の磁化が反転する。残留磁化状態 において、かかる交換結合力のために記録層の磁化の熱 安定性は向上する。また、磁化の変化率が極大となる領 20 域では、図4に示すようなマイナーヒステリシスループ・・・・【0048】本発明に従う磁気記録装置は、熱安定性に・・・ が観測され得る。とのマイナーヒステリシスループを図 5 に示す。マイナーヒステリシスループの中心点から求 めた交換結合磁界H。x は、強磁性原子リッチ層(また は格子間隔調整層)と記録層との間の交換結合力が増大 するとともに増大するため、交換結合磁界が大きいほど 熱安定性が増すことを示す。交換結合磁界H。x は、1 kOe以上、好ましくは1.5kOe以上であり、図1 8に示した従来型の磁気記録媒体に比べて著しく大き く、それゆえ、本発明の磁気記録媒体は熱安定性に優れ 30 るととがわかる。

【0044】本発明の第2の態様の磁気記録媒体におい て、このような大きな交換結合磁界H。x を生じさせる には、例えば、格子間隔調整層に含まれる磁性元素の割 合が、記録層に含まれる磁性元素の割合よりも大きくな るように、格子間隔調整層を形成することが望ましい。 【0045】本発明の第3の態様に従えば、磁気記録媒 体であって、強磁性材料から形成された記録層と;強磁 性材料から形成され、記録層の磁化を安定化させる磁化 安定化層と:上記記録層と上記磁化安定化層との間に存 40 在する非磁性層と;上記非磁性層と記録層の間並びに非 磁性層と磁化安定化層の間の少なくとも一方に存在し、 上記記録層を形成する強磁性材料よりも強磁性原子濃度 の高い強磁性材料から形成された強磁性原子リッチ層と を含む磁気記録媒体が提供される。

【0046】本発明の第3の態様の磁気記録媒体は、記 録層よりも強磁性原子濃度の高い強磁性原子リッチ層が 記録層の非磁性側の面または磁化安定化層の非磁性層側 の面を覆うように形成され得る。これにより、上述の第 1の態様の磁気記録媒体の場合と同様に、記録層と磁化 50

安定化層との交換結合が、強磁性原子リッチ層と記録層 を構成する磁性原子間における交換結合または磁性原子 と磁化安定化層を構成する磁性原子間における交換結合 により改善されて増大する。したがって、磁化安定化層 で安定化された記録層の磁化が、強磁性原子リッチ層に よる磁化安定化層と記録層との間の交換結合力の増大に よって、より一層安定化するため、従来よりも更に高密 度記録を実現することができる。第3の態様の磁気記録 媒体の強磁性原子リッチ層もまた、第1の態様の磁気記 録媒体の場合と同様に、磁化安定化層と記録層との間の 交換結合力を増大 (エンハンス) することから「エンハ ンス層」とも称する。強磁性原子リッチ層は、本発明の 第1の態様の磁気記録媒体と同じ材料を用いて構成し得

【0047】本発明の第4の態様に従えば、本発明の第 1、第2または第3の態様に従う磁気記録媒体と;上記 磁気記録媒体に情報を記録又は再生するための磁気へっ ドと:上記磁気記録媒体を上記磁気へッドに対して駆動 するための駆動装置と:を含む磁気記録装置が提供され

優れた磁気記録媒体を装着しているために、長時間に渡 る記録安定性に優れる。

[0049]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の磁気記録媒体及 び磁気記録装置を実施例及び比較例を用いて具体的に説 明する。ただし、本発明はこれらの実施例に限定されな 61

[0050]

【実施例1】本発明に従う磁気記録媒体の好ましい具体 例の断面図を図1に示す。磁気記録媒体10は、ガラス 基板20上に、第1下地層2、第2下地層4、磁化安定 化層6、第1エンハンス層(強磁性原子リッチ層)8、 磁気結合層(非磁性層)12、第2エンハンス層8、記 録層16及び保護層18を備える。各層は以下のように DCマグネトロンスバッタ装置を用いてスパッタリング により形成した。

【0051】直径2. 5 inch (6. 25 cm) のガ ラス基板20上に、第1金属下地層2として、NiA1 膜をDCマグネトロンスパッタ装置を用いてスパッタリ ングにより形成した。ターゲットには原子比でNi:A 1=50:50のNiAl合金を用いた。NiAl膜の 膜厚は50nmであった。スパッタ時のArガス圧は 0.3Pa、投入電力は0.5kWであった。基板は、 スパッタ開始前に、スパッタ室を1×10-5 Pa以下 に減圧した後に340℃に加熱した。この条件下での成 膜速度は約3 n m/秒であった。

【0052】第2金属下地層4として、CrMo膜を第 1金属下地層2上に膜厚20nmで形成した。ターゲッ トにはMo:27原子%のCrMo合金を用いた。成膜

条件は、第1金属下地層2の場合と同様にした。

【0053】磁化安定化層6として、CoCrPtB膜を第1金属下地層4上に膜厚6nmで形成した。ターゲットにはCo₆4 Cr₂。Pt₁2 B₄合金を用いた。成膜条件は、第1金属下地層2の場合と同様にした。 【0054】次いで、第1エンハンス層8として、Co

15

【0054】次いで、第1エンハンス層8として、Co膜を磁化安定化層6上に膜厚1nmで形成した。ターゲットにはCoを用いた。スパッタ時の成膜条件として、投入電力は100Wとし、基板とターゲット間の間隔を長くした以外は、第1金属下地層2の場合と同様にした。

【0055】次いで、磁気結合層12として、Ru膜を第1エンハンス層8上に膜厚0.8nmで形成した。ターゲットにはRuを用いた。スパッタ時の成膜条件は、第1エンハンス層8の場合と同様にした。

【0056】第2エンハンス層14としてのCo膜を、第1エンハンス層8と同様に形成した。第1エンハンス層8と同様に形成した。第1エンハンス層8及び第2エンハンス層14は、記録層16と磁化安定化層6との間の交換結合を増大させる働きを有する。
【0057】記録層16として、面内方向の磁化を有す 20るCoCrPtB膜を第2エンハンス層14上に膜厚1 8nmで形成した。ターゲットにはCo。4 Cr2。Pt12B4合金を用いた。成膜条件は、磁化安定化層6の場合と同様にした。

【0058】最後に、CoCrPtB記録層16上に、 保護膜としてのカーボン層を膜厚5nmで形成した。成 膜条件は、第1金属下地層2の場合と同様であった。こ うして図1に示した構造の磁気ディスク10を製造し た。

[0059]

【比較例1】比較例として、第1及び第2エンハンス層を形成しなかった以外は、実施例1と同様にして磁気ディスクを製造した。図7に、こうして得られた比較例の磁気ディスク50の構造を示す。

【0060】 [磁化曲線の評価] 実施例1で製造した磁気ディスクの磁化特性を以下のようにして測定した。VSM (Vibration Sample Magnetometer) により磁界を印加して外部磁界に対する磁化曲線を観測した。得られた結果を図4に示す。図4のヒステリシスループから分かるように、正方向の外部磁界を印加して磁化を飽和させた後、外部磁界を低下させてゆくと、外部磁界がゼロになる前に磁化が急激に低下する領域が存在する。この領域では、外部磁界に対する磁化の変化率(δM/δH)が極大となる点が現れている。そしてこの領域では磁化曲線がヒステリシスを示すマイナーループを描いている。このマイナーループが生じるのは、変化率の極大点に至る前は記録層16と磁化安定化層6の磁化の向きが反転するためであると考えられる。

【0061】図5(A)にマイナーループの拡大図を示 50 は、記録層と第2磁化安定化層間の交換結合を増大する

す。このマイナーループは、正方向の外部磁界を印加し て記録層及び磁化安定化層の磁化を飽和させた後、磁界 を低下させてゆき、磁化の変化率が安定化した後に、再 度外部磁界を増加させることにより求めた磁化曲線であ る。ととで、マイナーループの上端と下端の中点にある ループの中心における磁界Hは、記録層16と安定化層 6の磁化の交換結合を示す交換結合磁界H。」として知 られている。この実施例で得られた磁気ディスクの場 合、H。x は1.4kOeであることが分かった。一 方、比較例の磁気ディスクでは、図5 (B) に示すよう 10 なヒステリシスマイナーループが得られ、H。x は0. 4 k O e であることが分かった。従って、本発明では第 1及び第2エンハンス層を、記録層及び磁気結合層の界 面、並びに磁気結合層と磁化安定化層との界面にそれぞ れ設けたために、記録層と磁化安定化層との交換結合力 が著しく向上している。参考として、従来技術の説明の 欄で述べた文献に開示された磁気ディスクのH。」は4 50 (Oe)程度であることが報告されている。

【0062】さらに、実施例1及び比較例で得られた磁気記録媒体の活性化体積Vを測定し、磁気記録媒体の熱安定性の指標となる値である(Ku・V)/(k・T)を求めたところ、実施例1の磁気記録媒体では約71であったのに対して比較例の磁気記録媒体では65であった。このことからも、本発明の磁気記録媒体は熱安定性に優れることが分かる。さらに、実施例の磁気記録媒体では、面内磁気記録媒体の高密度記録の可能性を示す指標であるBrt(=4πMr・t(式中、Mrは残留磁界、tは厚みをそれぞれ示す))は、約44Gμmであった。

30 [0063]

【変形例1】本発明に従う磁気ディスクでは、記録層と磁化安定化層の間の交換結合をエンハンスするエンハンス層を、記録層及び磁気結合層(非磁性層)の界面、あるいは磁気結合層と磁化安定化層との界面のいずれか一方に設けてもよい。実施例1の変形例として、図3に第2エンハンス層を形成しなかった磁気ディスク40の構造を示す。

[0064]

【変形例2】実施例1では、磁化安定化層6及び磁気結合層12をそれぞれ一層ずつ形成したが、それらを2層ずつ形成してもよい。すなわち、CrMo第2下地層4上に、CoCrPtB第1磁化安定化層、第1エンハンス層、Ru第1磁気結合層、Co第2エンハンス層、CoCrPtB第2磁化安定化層、第3エンハンス層、Ru第2磁気結合層、Co第4エンハンス層、CoCrPtB記録層及びカーボン保護層を備える構造にすることができる。ここで、第1及び第2エンハンス層(補助エンハンス層)は、第1及び第2磁化安定化層間の交換結合を増大する作用を有し、第3及び第4エンハンス層

作用を有する。また、図3に示した磁気ディスク40に おいて、磁気結合層12と記録層16との間に、第2磁 化安定化層、第4エンハンス層及び第2磁気結合層を加 えても良い。

[0065]

【実施例2】実施例1と同様のプロセスにより複数枚の 磁気ディスクを作製し、各ディスクの保護層上に潤滑剤 を塗布した後、それらを磁気記録装置のスピンドルに同 軸上に取り付けた。磁気記録装置の概略構成を図8及び 図9に示す。図8は磁気記録装置の上面の図であり、図 10 9は、図8の破線A-A'における磁気記録装置60の 断面図である。記録用磁気ヘッドとして、2.1Tの高 飽和磁束密度を有する軟磁性膜を用いた薄膜磁気ヘッド を用い、再生のために巨大磁気抵抗効果を有するデュア ルスピンバルブ型磁気ヘッドを用いた。記録用磁気ヘッ ド及び再生用磁気ヘッドは一体化されており、図8及び 図9では磁気ヘッド53として示した。この一体型の磁 気ヘッド53は磁気ヘッド用駆動系54により制御され る。複数の磁気ディスク10は回転駆動系51のスピン ドル52により同軸回転される。磁気記録装置の磁気へ 20 ッド面と磁気ディスタとの距離は11nmに保った。こ の磁気ディスクに40Gbits/inch² (6.2) OGbits/cm²) に相当する信号を記録して磁気 ディスクのS/Nを評価したところ、25dBの再生出 力が得られた。

【0066】磁気記録装置60の記録安定性を評価するために、磁気記録装置60を80℃、湿度80%の環境下に100時間置いた。100時間経過後に、記録した信号を再生して磁気ディスクのS/Nを測定したととろ、24.3dBの再生出力が得られた。すなわち、上30記環境下での記録信号の低下率は3%であった。

[0067]

【比較例2】比較例1の磁気ディスク50を実施例2と同様にして磁気記録装置に組み込んだ。この磁気記録装置の記録安定性を評価するために、磁気記録装置60を80℃、湿度80%の環境下に100時間置いた。100時間経過後に、記録した信号を再生して磁気ディスクのS/Nを測定したところ、22.5dBの再生出力が得られた。すなわち、上記環境下での記録信号の低下率は10%であった。従って、本発明の磁気ディスクを備える磁気記録装置は記録安定性に関して優れていることが分かる。

[0068]

【実施例3】本発明に従う磁気記録媒体の別の具体例の 概略構成を図10に示す。磁気記録媒体70は、ガラス 基板20上に、第1下地層2、第2下地層4、強磁性原 子リッチ層78、磁気結合層(非磁性層)12、記録層 16及び保護層18を備える。各層は以下のようにDC マグネトロンスパッタ装置を用いてスパッタリングによ り形成した。 【0069】まず、直径2.5inch(6.25cm)のガラス基板をDCマグネトロンスパッタ装置の準備室に装填した。準備室を減圧し、真空度を1×10⁻⁵Paにした後、ガラス基板上の水分を除去するためにガラス基板を200℃で10分間加熱した。次いで、ガラス基板を、準備室から、1×10⁻⁵Paの真空度を有する成膜室に搬送した。成膜室において、ガラス基板を340℃まで加熱した。

[0070] 加熱されたガラス基板20上に、第1金属下地層2として、NiA1膜を形成した。ターゲットには原子比でNi:A1=50:50のNiA1合金を用いた。NiA1膜の膜厚は50nmであった。スパッタ時のArガス圧は0.3Pa、投入電力は500 $\mathbb W$ であった。

[0071]第2金属下地層4として、CrMo膜を第1金属下地層2上に膜厚20nmで形成した。ターゲットにはMo:27原子%のCrMo合金を用いた。成膜条件は、第1金属下地層2の場合と同様にした。

【0072】次いで、強磁性原子リッチ層78として、 CoPt膜を第2金属下地層上に膜厚2nmで形成した。ターゲットにはPt:17原子%のCoP-t合金を用いた。スパッタ時の成膜条件として、投入電力は100Wとし、基板とターゲット間の間隔を長くした以外は、第1金属下地層2の場合と同様にした。

【0073】次いで、磁気結合層12として、Ru膜を強磁性原子リッチ層78上に膜厚0.8nmで形成した。ターゲットにはRuを用いた。スパッタ時の成膜条件は、強磁性原子リッチ層78の場合と同様にした。【0074】記録層16として、面内方向の磁化を有するCoCrPtB膜を磁気結合層上に膜厚18nmで形成した。ターゲットにはCos4Cr2oPt12B4合金を用いた。成膜条件は、第1金属下地層2の場合と同様にした。

【0075】最後に、CoCrPtB記録層16上に、 保護膜としてのカーボン層を膜厚5nmで形成した。成 膜条件は、第1金属下地層2の場合と同様であった。こ うして図10に示した構造の磁気ディスク70を製造し た。

【0076】とうして得られた磁気ディスクについて、 実施例1と同様に、VSMにより磁界を印加して外部磁 界に対する磁化曲線を観測した。得られた結果を図11 に示す。このヒステリシスループからわかるように、こ の実施例で製造された磁気ディスクも、実施例1で製造 した磁気ディスクと同様に、正方向の外部磁界を印加し て磁化を飽和させた後、外部磁界を低下させてゆくと、 外部磁界がゼロになる前に磁化が急激に低下する領域が 存在していた。そして、図11からわかるように、この 領域で、磁化曲線がヒステリシスを示すマイナーループ を描いていた。図11の下方にマイナーループの拡大図 を示した。このマイナーループから、実施例1で製造し た磁気ディスクの場合と同様にして交換結合磁界H。よ を求めたところ、交換結合磁界H。 は、1.7kOe であった。

【0077】つぎに、上記プロセスと同様にして複数枚 の磁気ディスクを作製し、それぞれの磁気ディスクの保 護層上に潤滑剤を塗布した後、それらを実施例2と同様 に図8及び図9に示す磁気記録装置に組み込んだ。との 磁気記録装置を用いて、実施例2と同様に磁気ディスク に信号を記録して磁気ディスクのS/Nを評価したとこ ろ、25dBの再生出力が得られた。

【0078】次いで、かかる磁気記録装置の記録安定性 を評価するために、実施例2の場合と同様に磁気記録装 置を80℃、湿度80%の環境下に100時間置いた。 100時間経過後に、記録した信号を再生して磁気ディ スクのS/Nを測定したところ、24.5dBの再生出 力が得られた。すなわち、上記環境下での記録信号の低 下率は2%であった。したがって、比較例2の磁気記録 装置との比較から、本発明の磁気ディスクを備える磁気 記録装置は記録安定性に関して優れていることがわか る。

[0079]

【変形例3】実施例3で製造した磁気ディスクの変形例 として、図12に示すように、磁気結合層12と記録層 16との界面にエンハンス層79を設けてもよい。エン ハンス層79は、実施例1で作製した磁気ディスクのエ ンハンス層8と同様の材料を用いて形成することがで き、記録層16と強磁性原子リッチ層78との間の交換 結合を増大する作用を有する。

[0080]

【変形例4】実施例3で製造した磁気ディスクの別の変 30 形例として、図13に示すように、第2下地層3上に、 更に記録層16の磁化を安定化させるための磁化安定化 層86及び第2磁気結合層82を設けてもよい。磁化安 定化層86は、実施例1で作製した磁気ディスクの磁化 安定化層6と同様の材料を用いることができる。第2磁 気結合層82は、実施例3と同様にRuを用いることが できる。また、更に別の変形例として、図13に示した 磁気ディスクにおいて、磁化安定化層86を、実施例1 で用いたエンハンス層で置き換えて構成することも可能 である。

[0081]

【実施例4】この実施例では、磁気記録媒体の更に別の 好ましい具体例について説明する。この実施例では、実 施例3で作製した図10に示す構造の磁気ディスクの強 磁性原子リッチ層を格子間隔調整層に変更して磁気記録 媒体を作製した。 すなわち、図6 に示すように、ガラス 基板20上に、第1下地層2、第2下地層4、格子間隔 調整層66、磁気結合層12、記録層16及び保護層1 8を備える磁気ディスクを作製した。本実施例では、格

20

スクの強磁性原子リッチ層78と同じ磁性材料を用い た。実施例3においては、強磁性原子リッチ層78を、 基板とターゲットの間隔を長くして成膜したが、本実施 例では、格子間隔調整層66を、基板とターゲットの間 隔を長くせずに成膜した。磁気結合層12は、基板とタ ーゲットの間隔を長くした以外は、実施例3と同様にし て成膜した。これら格子間隔調整層66と磁気結合層1 2以外の層は、実施例3と同様の方法により成膜した。 【0082】また、比較例3として、図6に示した磁気 10 ディスクにおいて、格子間隔調整層66の代わりに、記 録層10と同組成のCoCrPtB膜を成膜して磁気デ ィスクを作製した。CoCrPtB膜の膜厚は4.5n mとし、記録層の膜厚は上記と同様に18 n mとした。 【0083】 [磁化曲線の評価] 本実施例の磁気ディス ク及び比較例3の磁気ディスクの磁化測定を以下のよう にして行った。VSM(Vibrating Sample Magnetomete r) により磁界を印加して外部磁界に対する磁化曲線を 観測した。得られた結果を図14に示す。図14のヒス テリシスループからわかるように、正方向の外部磁界を 20 印加して磁化を飽和させた後、外部磁界を低下させてい くと、外部磁界がゼロになる前に、ある磁界で磁化が急 激に減少する領域がある。これは記録層と格子間隔調整 層の間に働く交換結合の影響によって引き起こされる現 象であり、磁気記録媒体の磁化が飽和しているときは、 記録層と格子間隔調整層の磁化はともに平行であるが、 外部磁界が低下して、格子間隔調整層の磁化が反転して 記録層の磁化方向と反平行になるために生じる。

【0084】 ここで、図14に示したヒステリシスルー プから記録層の保磁力を求めた。以下に、保磁力の求め 方について説明する。図14に示したヒステリシスルー プは、磁気記録媒体のヒステリシスループであり、ヒス テリシスループ上の磁化の値は、磁性材料からそれぞれ 構成された記録層と格子間隔調整層の磁化の和を示して いる。一方、記録層の保磁力は、通常、記録層の磁化の みが描くヒステリシスループにおいて記録層の磁化の大 きさがゼロになったときの外部磁界の大きさで定義され る。そとで、図14に示したヒステリシスループから、 以下のようにして記録層の保磁力を見積もった。図14 に示したヒステリシスループにおいては、記録層の磁化 がゼロのときは格子間隔調整層の磁化のみが検出されて いるはずであり、この場合の格子間隔調整層の磁化の大 きさをM., とすれば、図14のヒステリシスループ において-M., の磁化が得られるときの外部磁界の 大きさが、記録層の磁化がゼロのときの外部磁界、すな わち記録層の保磁力を示すことになる。そして、M 。 、。は、図14のヒステリシスループから次のように して見積もることができる。

【0085】図14に示したヒステリシスループでは、 前述したように、正方向の外部磁界を印加して磁化を飽 子間隔制御層66として、実施例3で作製した磁気ディ 50 和させた後、外部磁界を低下させていくと、図14に示

すように、ループ上のA点とB点との間で磁化が急激に 減少している。このA点とB点との間の磁化の急激な減 少は、記録層の磁化の方向は変化せずに格子間隔調整層 の磁化のみが反転したととによる。ループ上のA点では 記録層と格子間隔調整層の磁化の向きは平行であり、A 点での磁化は記録層と格子間隔調整層の磁化の和を表 す。一方、B点ではそれの層の磁化の向きが反平行とな るので、B点での磁化は記録層と格子間隔調整層の磁化 の差を表す。したがって、前述の格子間隔調整層の磁化 M. . . は、ループ上のA点における磁化の値とB点に 10 おける磁化の値との差の半分として見積もることができ

【0086】かかる方法により、図14のヒステリシス ループから記録層の保磁力を求めたところ、約4.5k Oeであった。一方、比較例3の磁気ディスクの記録層 についても同様の方法により保磁力を求めたところ、記 録層の保磁力は約3.5k0eであった。つまり、本実 施例の磁気ディスクの記録層は、比較例3の磁気ディス クの記録層よりも、保磁力が約30%増加した。

【0087】第2下地層4と記録層10の配向関係は、 CrMo (211) [110] //CoCrPtB(1 0・0) [0001] である。第2下地層4であるCr Mo [110]の格子間隔は4.182点、本実施例に おいて格子間隔調整層6として用いられたCoPtの 「0001]の格子間隔は4.178点、記録層10と して用いられたCoCrPtBの格子間隔は4.159 Aである。前述の式(1)から、記録層10と第2下地 層4との格子間隔のミスマッチ△1、及び格子間隔調整 層6と第2下地層4との格子間隔のミスマッチ△2を求 めると、 $\Delta 1 = 0.550\%$ 、 $\Delta 2 = 0.096\%$ であ り、△1>△2を満足している。一方、比較例の磁気デ ィスクでは、記録層及び格子間隔調整層はともに同組成 の $C \circ C \circ P \circ B$ であるために、ミスマッチ $\Delta 1 = \Delta 2$ =0.550%である。したがって、第2下地層である CrMo上に格子間隔調整層を成膜する場合、CoPt を格子間隔調整層に用いた方が、CoCrPtBを用い た場合よりも、下地層と記録層との間の格子間隔のミス マッチを小さくできるので、記録層の結晶性を向上させ るととができる。

【0088】ところで、図14のヒステリシスループに おいて、磁界が0になる前に磁化が急激に低下する領域 では、外部磁界に対する磁化の変化率(δM/δH)が 極大となる点が現れている。との極大点が出現した後に 更に磁界を低下させてゆき、磁化の変化率が安定化した 後に再度外部磁界を増加させると、図16の斜線に示す ようにヒステリシス曲線が得られる。このヒステリシス 曲線をマイナーループと呼ぶ。ここで、マイナーループ の上端と下端の中点にあるループの中心における磁界H は、記録層10と格子間隔調整層6の磁化の交換結合に 比例する交換結合磁界Hexとして知られている。この 50 ク(第1及び第2エンハンス層の強磁性原子濃度は10

実施例で得られた磁気ディスクの場合、Hexは約1. 0k0eであることがわかった。一方、比較例3の磁気 ディスクの場合、マイナーループより求められたHex は、0.4k0eであることがわかった。したがって、 本発明では、格子間隔調整層の磁性元素の割合を、記録 層よりも増加させることにより、格子間隔調整層と記録 層との交換結合力が増大されている。

【0089】つぎに、本実施例及び比較例3の磁気ディ スクについて、磁気ディスクの熱安定性の指標となる値 (Ku・V)/(kg・T)(Kuは記録層の結晶磁気 異方性定数、Vは活性化体積、kgはボルツマン定数、 Tは絶対温度を表す)を求めたところ、本実施例の磁気 ディスクでは、約78であったのに対し、比較例3の磁 気記録媒体では約65であった。このことからも、本発 明の磁気記録媒体は熱安定性に優れることがわかる。更 に、本実施例の磁気ディスクでは、面内磁気記録媒体の 高密度記録の可能性を示す指標であるBrtは、約4 9.7 $G\mu$ mであった。

【0090】つぎに、格子間隔調整層を種々の膜厚で形 成した以外は、上記と同様のプロセスにより磁気ディス クを製造して、格子間隔調整層の膜厚の異なる複数の磁-気ディスクを得た。そして、それぞれの磁気ディスクに ついて上記と同様にVSMにより磁化曲線を観測して記 録層の保磁力を求めた。図15に、格子間隔調整層であ るCoPt層の膜厚と、記録層の保磁力の関係を示す。 この結果からわかるように、CoPt膜の膜厚の増加に 伴って記録層の保磁力も増大している。

【0091】次いで、格子間隔調整層の膜厚の異なるそ れぞれの磁気ディスクについて、上記と同様の方法によ り交換結合磁界を測定し、格子間隔調整層の膜厚に対す る交換結合磁界の依存性を調べた。結果を図15のグラ フに示す。とのグラフからわかるように、格子間隔調整 層の膜厚が増加するに伴って、交換結合磁界は減少して いる。図15から、格子間隔調整層をCoPt層で構成 した場合、記録層の保磁力と交換結合磁界をともにバラ ンス良く高めることが可能な格子間隔調整層の最適な膜 厚は1.0nm~2.0nmであることがわかる。

[0092]

【実施例5】との実施例では、第1エンハンス層(強磁 40 性原子リッチ層)及び第2エンハンス層を形成する強磁 性材料を、ともに、Coe 2 Cr2 2 Pt1 2 B4、C o. 4 Cr2 o Pt 1 2 B 4 及びCos 3 Cr 1 7 に変 更した以外は、実施例1と同様にして第1エンハンス層 の強磁性原子濃度の異なる3種類の磁気ディスクを作製 した。すなわち、Ru層(磁気結合層)に接する第1エ ンハンス層と第2エンハンス層の強磁性原子濃度を、6 2%、64%、83%に変化させた。こうして得られた 第1エンハンス層の強磁性原子濃度がそれぞれ異なる3 種類の磁気ディスクと、実施例1で作製した磁気ディス

0%)とについて、記録層と第1エンハンス層との間の 交換結合エネルギーJを調べた。交換結合エネルギーJ は、次式(2)から求めた。

[0093]

 $J = H_{e \times} \times (Ms \times t + Ms_{E} \times t_{E}) \cdot \cdot \cdot (2)$ 【0094】上記式(2)中、Hexは、記録層と磁化 安定化層の磁化の交換結合を示す交換結合磁界であり、 Ms及びMs はそれぞれ磁化安定化層及び第1エンハ ンス層の飽和磁化を示し、t及びtgはそれぞれ磁化安 定化層及び第1エンハンス層の膜厚を示す。交換結合磁 10 界H., は実施例1で示した方法と同様の方法により求 めた。

【0095】図17(A)に、第1エンハンス層のCo 濃度に対する交換結合エネルギーの変化を示す。 図17 (A) に示すように、第1エンハンス層の強磁性原子濃 度(Co濃度)が高くなるに従って記録層と磁化安定化 層との間の交換結合エネルギーが増大していることがわ かる。第1エンハンス層の強磁性原子(Co)濃度が8 3%以上の磁気記録媒体では、第1エンハンス層の強磁 性原子(Co) 濃度が64%の磁気記録媒体(第1エン 記録媒体)と比較して交換結合エネルギーが約5倍に増 大している。すなわち、第1エンハンス層の強磁性原子 濃度を記録層の強磁性原子濃度よりも絶対値で19%

(記録層の強磁性原子濃度に対する相対値で約30%) 以上増加させることにより交換結合エネルギーを約5倍 に増大することができた。第1エンハンス層の強磁性原 子濃度を100%にすると更に交換結合エネルギーは増 大し、第1エンハンス層の強磁性原子(Co)濃度が6 4%の磁気記録媒体に比べて約8.75倍に増加してい 30 た。一方、第1エンハンス層の強磁性原子濃度が記録層 の強磁性原子濃度よりも低い磁気記録媒体の交換結合エ ネルギーは、第1エンハンス層の強磁性原子(Co)濃 度が64%の磁気記録媒体すなわち第1エンハンス層と 記録層の強磁性原子濃度がともに等しい磁気記録媒体よ りも低くなっている。また、各磁気記録媒体について熱 安定性の指標である(Ku·V)/(k』·T)を測定 した。測定結果を図17(B)に示す。図17(B)か らわかるように、第1エンハンス層の強磁性原子濃度を 記録層の強磁性原子濃度よりも高めることにより、(K 40 u·V) / (kg·T) も交換結合エネルギーと同様に 向上している。かかる結果から、第1エンハンス層(強 磁性原子リッチ層)の強磁性原子濃度を記録層の強磁性 原子濃度よりも高めることによって熱安定性の優れた磁 気記録媒体を得ることができる。

[0096]

【実施例6】との実施例では、本発明の磁気記録媒体の 更に別の具体例について説明する。図2に、本実施例の 磁気記録媒体の概略断面図を示す。磁気記録媒体30 は、ガラス基板20上に、第1下地層2、第2下地層

4、磁化安定化層6、磁気結合層12、強磁性原子リッ チ層(第2エンハンス層)14、記録層16及び保護層 18を備える。かかる磁気記録媒体30は、実施例1に おいて作製した図1に示す構造の磁気ディスクの第2エ ンハンス層を強磁性原子リッチ層として用い、第1エン ハンス層を形成しなかった以外は、実施例1と同様にし て作製することができる。また、図2に示した磁気記録 媒体30の変形例として、強磁性原子リッチ層(第2エ ンハンス層) 14と記録層 16との間に、更に、第2磁 化安定化層、第2磁気結合層及び第4エンハンス層を加 えても良い。

【0097】以上、本発明を実施例により具体的に説明 してきた。例えば、実施例1は、本発明の第1または第 3の態様を具現化する例である。しかしながら、本発明 はそれらに限定されない。基板、第1金属下地層、第2 金属下地層、強磁性原子リッチ層、格子間隔調整層、磁 化安定化層、磁気結合層、第1エンハンス層、第2エン ハンス層、及び記録層は、実施例で示した材料に限ら ず、種々の知られた材料で構成することができる。

[0098]

記録層を形成する強磁性材料よりも強磁性原子濃度の高 い強磁性材料から形成された強磁性原子リッチ層によ り、記録層と強磁性原子リッチ層との間で強い交換結合 力が発生するので熱安定性に優れる。従って、高密度記 録のために微小磁区を形成しても、熱揺らぎが少なく、 記録した情報を長期間に渡って安定に保持することがで

【0099】本発明の第2の態様の磁気記録媒体は、下 地層と記録層との格子間隔のミスマッチを緩和するよう な格子間隔を有する格子間隔調整層により、記録層の結 晶配向性が向上しているので、記録層の保磁力が増大さ れている。これにより記録層に微小な磁区を形成するこ とができ、更なる高密度化を実現できる。更には、格子 間隔調整層中の磁性元素の割合を記録層よりも増加させ ることにより、格子間隔調整層と記録層との間の交換結 合力を増大させることができる。かかる磁気記録媒体 は、熱安定性に優れ、且つ、高保磁力であるため、超高 密度記録が可能である。

【0100】本発明の第3の態様の磁気記録媒体は、強 磁性原子リッチ層により記録層と磁化安定化層との間の 交換結合力が増大しているので、第1の態様の磁気記録 媒体と同様に熱安定性に優れ、高密度記録のために微小 磁区を形成しても、熱揺らぎが少なく、記録した情報を 長期間に渡って安定に保持することができる。

【0101】本発明の第1、第2または第3の態様の磁 気記録媒体を備える磁気記録装置は、記録安定性に優 れ、例えば、40Gbits/inch² (6. 20G bits/cm²)を超える超高密度磁気記録の実現を 50 可能にする。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1の磁気ディスクの断面構造を示す図である。

25

【図2】実施例1の磁気ディスクの変形例の断面構造を示す図である。

【図3】実施例1の磁気ディスクの別の変形例の断面構 造を示す図である。

【図4】実施例1の磁気ディスクのヒステリシスループ (メジャーループ) を示すグラフである。

【図5】図4におけるヒステリシスループのマイナール 10 ープを示すグラフである。

【図6】本発明の実施例4に従う磁気ディスクの概略断面構造を示す図である。

【図7】比較例1の磁気ディスクの断面構造を示す図である。

【図8】本発明の実施例2に従う磁気記録装置の一例を 上方から見た概略構成図である。

【図9】図8に示す磁気記録装置のA - A' 方向の断面図である。

【図10】本発明の実施例3で製造した磁気ディスクの 20 概略断面図である。

【図11】図10に示す磁気ディスクのヒステリシスループ(メジャーループ)と、ヒステリシスループのマイナーループの拡大図を示すグラフである。

【図12】本発明の実施例3に従う磁気ディスクの変形 例の概略断面図である。

【図13】本発明の実施例3に従う磁気ディスクの別の 変形例の概略断面図である。

【図14】実施例4の磁気ディスクのヒステリシスルー*

* プ (メジャーループ) を示すグラフである。

【図15】実施例4の磁気ディスクの格子間隔調整層の 膜厚と記録層の保磁力との関係及び格子間隔調整層の膜 厚と交換結合磁界の関係を示すグラフである。

【図16】図2 におけるヒステリシスループのマイナー ループを模式的に示したグラフである。

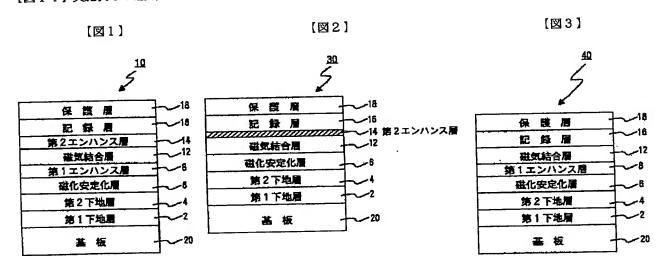
【図17】図17(A)は、強磁性原子リッチ層の強磁性原子(Co) 濃度に対する交換結合エネルギーの変化を示し、図17(B)は、強磁性原子リッチ層の強磁性原子(Co) 濃度に対する(Ku・V)/kg・Tの変化を示すグラフである。

【図18】従来の磁気ディスクの構造を示す断面図である。

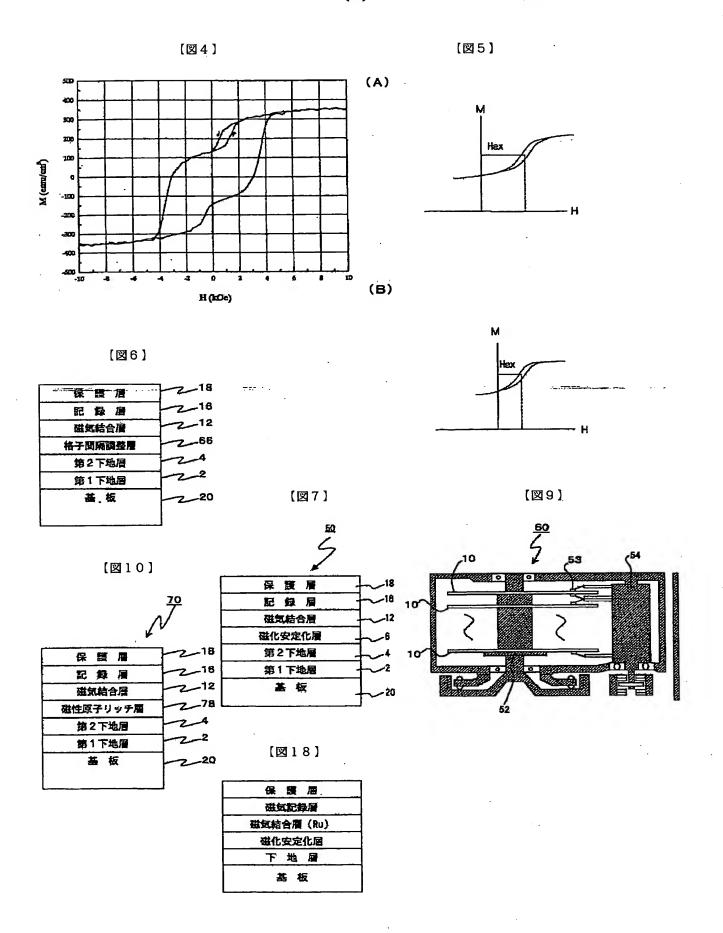
【符号の説明】

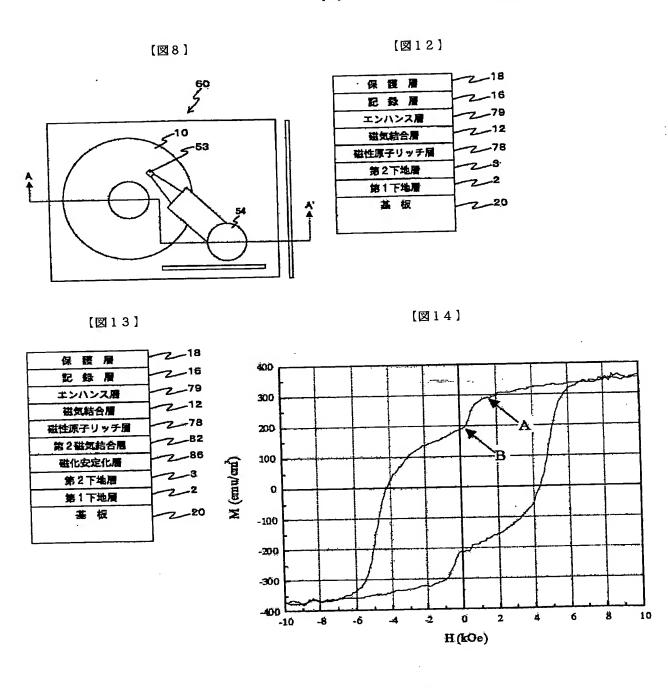
- 2 第1金属下地層
- 4 第2金属下地層
- 6 磁化安定化層
- 8 第1エンハンス層
- 10 磁気ディスク
- 0 12 磁気結合層
 - 14 第2エンハンス層
 - 16 記録層
 - 20 基板
 - 52 スピンドル
 - 53 磁気ヘッド
 - 60 磁気記録装置
 - 66 格子間隔調整層

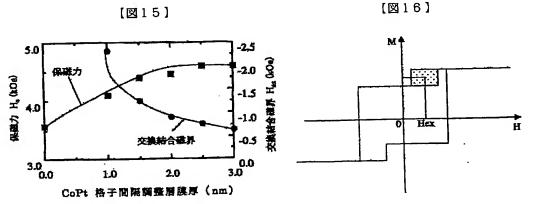
78 強磁性原子リッチ層



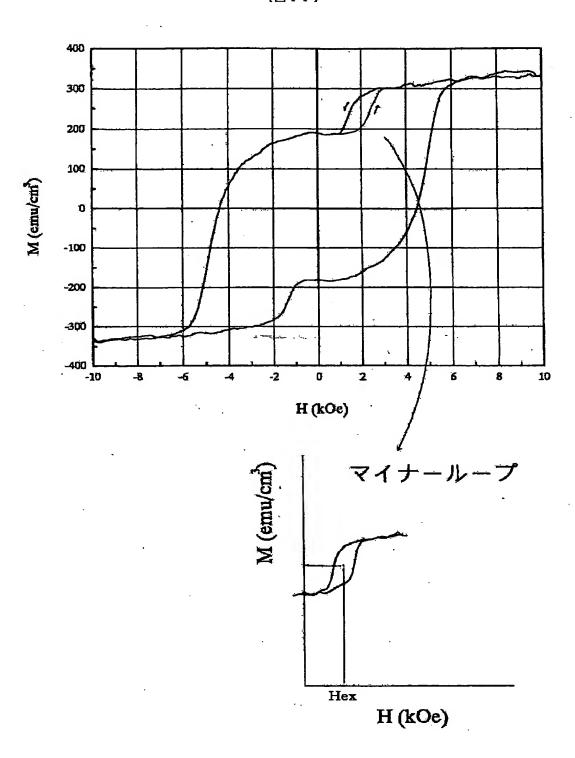
- :- ;-:



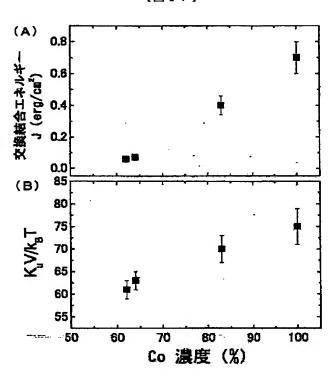




【図11】







【手続補正書】

【提出日】平成13年9月6日(2001.9.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項4

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項4】 更に、上記記録層の磁化を安定化させる磁化安定化層を備え、該磁化安定化層と記録層との間に上記強磁性原子リッチ層が位置し、上記強磁性原子リッチ層が上記磁化安定化層と記録層との間の交換結合を増大する第1エンハンス層として機能する請求項1に記載の磁気記録媒体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項6】 上記記録層が、Co、NiまたはFeを含む材料から形成されており、第1エンハンス層は上記記録層よりも高濃度のCo、NiまたはFeを含む材料から形成されていることを特徴とする請求項4に記載の磁気記録媒体。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項8】 <u>第1</u>エンハンス層が、0.2~2nmの 膜厚を有する請求項4に記載の磁気記録媒体。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正内容】

【0043】本発明の第1及び第2の態様の磁気記録媒体は、それぞれ、例えば、図4及び図16に示すような磁化曲線で表されるヒステリシスループで表される磁気特性を有する。以下、第1の態様の磁気記録媒体の場合に基づいて説明するが、第2の態様の磁気記録媒体においても格子間隔調整層と記録層との間で同様の関係がある。図4に示したヒステリシスループでは、磁気記録媒体の磁化を飽和させた後に外部磁界を低下させたときに、外部磁界に対する磁化の変化率が極大を示す点が正の外部磁界の領域に存在する。磁気記録媒体の磁化が飽和しているときには、記録層と強磁性原子リッチ層(または格子間隔調整層)の磁化がともに平行である。外部磁界が低下して磁化の変化率が極大となる領域で、強磁性原子リッチ層(または格子間隔調整層)と記録層との

間で働く交換結合力のために、強磁性原子リッチ層(または格子間隔調整層)の磁化が反転する。残留磁化状態において、かかる交換結合力のために記録層の磁化の熱安定性は向上する。また、磁化の変化率が極大となる領域では、図4に示すようなマイナーヒステリシスループが観測され得る。このマイナーヒステリシスループを図5(A)に示す。マイナーヒステリシスループの中心点から求めた交換結合磁界H。よは、強磁性原子リッチ層(または格子間隔調整層)と記録層との間の交換結合一が増大するとともに増大するため、交換結合磁界が大きいほど熱安定性が増すことを示す。交換結合磁界H。よは、1kOe以上、好ましくは1.5kOe以上であ

*り、図18に示した従来型の磁気記録媒体に比べて著しく大きく、それゆえ、本発明の磁気記録媒体は熱安定性 に優れることがわかる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図5

【補正方法】変更

【補正内容】

【図5】図5 (A) は、実施例1の磁気ディスクのマイナーヒステリシスループを示し、図5 (B) は、比較例1の磁気ディスクのマイナーヒステリシスループを示す。

【手続補正書】

【提出日】平成14年1月18日(2002.1.1 8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項16

【補正方法】変更 ---

【補正内容】

【請求項16】 更に、

 $\Delta 2 < \Delta 1 < 10.25$

且つ

 $(5/10.25) < (\Delta 2/\Delta 1) < 1$

の関係を満たすことを特徴とする請求項15 に記載の磁 気記録媒体。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正内容】

【0022】上述のように磁化安定化層を設け、磁化安定化層と記録層との間に強磁性原子リッチ層を位置付けた場合、磁化安定化層を第1及び第2磁化安定化層から構成し、第1磁化安定化層と第2磁化安定化層との間に第2の非磁性層を設け得る。この場合、第1磁化安定化層と第2時代層との間、及び、第2非磁性層と第2磁化安定化層との間の少なくとも一方に、第1磁化安定化層と第2磁化安定化層との間の交換結合を増大する補助エンハンス層を備え得る。さらに、上記補助エンハンス層が、第1非磁性層及び第1磁化安定化層の間に形成された第1補助エンハンス層と;第1非磁性層及び第2磁化安定化層の間に形成された第2補助エンハンス層と;を含み得る。補助エンハンス層は、上記エンハンス層と同じ材料から構成され得る。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正内容】

【0046】本発明の第3の態様の磁気記録媒体は、記 録層よりも強磁性原子濃度の高い強磁性原子リッチ層が 記録層の非磁性層側の面または磁化安定化層の非磁性層 側の面を覆うように形成され得る。これにより、上述の 第1の態様の磁気記録媒体の場合と同様に、記録層と磁 化安定化層との交換結合が、強磁性原子リッチ層と記録 層を構成する磁性原子間における交換結合または強磁性 原子リッチ層と磁化安定化層を構成する磁性原子間にお ける交換結合により改善されて増大する。したがって、 磁化安定化層で安定化された記録層の磁化が、強磁性原 子リッチ層による磁化安定化層と記録層との間の交換結 合力の増大によって、より一層安定化するため、従来よ りも更に高密度記録を実現することができる。第3の態 様の磁気記録媒体の強磁性原子リッチ層もまた、第1の 態様の磁気記録媒体の場合と同様に、磁化安定化層と記 録層との間の交換結合力を増大(エンハンス)すること から「エンハンス層」とも称する。強磁性原子リッチ層 は、本発明の第1の態様の磁気記録媒体と同じ材料を用 いて構成し得る。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0085

【補正方法】変更

【補正内容】

【0085】図14に示したヒステリシスループでは、前述したように、正方向の外部磁界を印加して磁化を飽和させた後、外部磁界を低下させていくと、図14に示すように、ループ上のA点とB点との間で磁化が急激に減少している。このA点とB点との間の磁化の急激な減少は、記録層の磁化の方向は変化せずに格子間隔調整層の磁化のみが反転したことによる。ループ上のA点では記録層と格子間隔調整層の磁化の向きは平行であり、A点での磁化は記録層と格子間隔調整層の磁化の和を表

す。一方、B点ではそれ<u>ぞれ</u>の層の磁化の向きが反平行となるので、B点での磁化は記録層と格子間隔調整層の磁化の差を表す。したがって、前述の格子間隔調整層の磁化M. . . . は、ループ上のA点における磁化の値とB点における磁化の値との差の半分として見積もることができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図16

【補正方法】変更

【補正内容】

【図 16 】図 14 におけるヒステリシスループのマイナーループを模式的に示したグラフである。

【手続補正6】

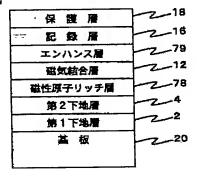
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図12

【補正方法】変更

【補正内容】

【図12】



*【手続補正7】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図13

【補正方法】変更

【補正内容】

【図13】



*

フロントページの続き

(72)発明者 神田 哲典

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 藤田 塩地

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 松沼 悟

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(72)発明者 竹内 輝明

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

Fターム(参考) 5D006 BB01 BB02 BB07 BB08 CA06